MOISTURE-CURABLE COMPOSITION

Publication number: JP2001172515 (A)

Publication date:

2001-06-26

OKADA TAKAYUKI; NAKAMURA HIROMASA; TABUCHI

HITOSHI; MORI KIYOMI +

Applicant(s): NIT

NITTO KASEI CO LTD +

Classification:

Inventor(s):

- international:

C08K5/57; C08K5/5419; C08L101/00; C08L101/02;

C08L101/16; C08K5/00; C08L101/00; (IPC1-7): C08L101/16;

C08K5/57

- European:

Application number: JP19990362936 19991221 **Priority number(s):** JP19990362936 19991221

Abstract of JP 2001172515 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a modified-silicone-based moisture-curable composition of which the stability of a cure catalyst is excellent. SOLUTION: This composition mainly comprises (A) 100 pts.wt. silyl-group- containing organic polymer having at least one silicon atom bonded to a hydrolyzable group at the molecular end or in the side chain and (B) 0.1-10 pts.wt. cure catalyst, provided the catalyst is a mixture comprising 80-50 wt.% dialkyltin compound and 20-50 wt.% silicate compound.

Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

Also published as:

P3449956 (B2)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-172515 (P2001-172515A)

(43)公開日 平成13年6月26日(2001.6.26)

(51) Int.Cl.⁷ C 0 8 L 101/16 C 0 8 K 5/57 識別記号

テーマコート*(参考) 4 J 0 0 2

C 0 8 K 5/57 C 0 8 L 101/00

FΙ

審査請求 有 請求項の数3 OL (全 9 頁)

特贖平11-362936	(71)出願人	000227342				
		日東化成株式会社				
平成11年12月21日(1999. 12. 21)		大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目17番14 号				
	(72)発明者	岡田 貴之				
		大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目17番14 号 日東化成株式会社内				
	(72)発明者	中村 博征				
		大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目17番14				
		号 日東化成株式会社内				
	(74)代理人	100065226				
		弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)				
		最終頁に続く				
		平成11年12月21日(1999. 12. 21) (72)発明者 (72)発明者				

(54) 【発明の名称】 湿気硬化性組成物

(57)【要約】

【課題】 硬化触媒の安定性が優れた変性シリコーン系 湿気硬化性組成物を提供する。

【解決手段】 分子末端又は側鎖に、加水分解性基と結合した珪素原子を1分子中に少なくとも1個有するシリル基含有有機重合体(A)100重量部と硬化触媒(B)0.1~10重量部を主要成分とする組成物にお

(B) 0.1~10里量部を主要成分とする組成物において、硬化触媒(B)が、ジアルキル錫化合物80~50重量%とシリケート化合物20~50重量%との混合物であることを特徴とする湿気硬化性組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子末端又は側鎖に、加水分解性基と結合した珪素原子を1分子中に少なくとも1個有するシリル基含有有機重合体(A)100重量部と硬化触媒

(B) $0.1 \sim 10$ 重量部を主要成分とする組成物において、硬化触媒(B)が、ジアルキル錫化合物 $80 \sim 5$ 0 重量%とシリケート化合物 $20 \sim 50$ 重量%との混合物であることを特徴とする湿気硬化性組成物。

【請求項2】 ジアルキル錫化合物が一般式(1): R^{1} ₂SnX₂ (1)

(式中、 R^1 は炭素原子数 $1\sim12$ の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基であり、Xは炭素原子数 $1\sim18$ の直鎖状または分岐鎖状のアルコキシル基、オルガノシリケート基、炭素原子数 $1\sim8$ の直鎖状または分岐鎖状のアセト酢酸アルキルエステル基、アセチルアセトン基よりなる群から選択される基である)で表される化合物である請求項1記載の湿気硬化性組成物。

【請求項3】 シリケート化合物が一般式(2): R^{2}_{n} S i (OR 3)_{4-n} (2)

(式中、 R^2 および R^3 はそれぞれ独立に炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基であり、m個の R^2 、(4-m) 個の R^3 は同一であっても異なっていてもよく、mは $0\sim 3$ の整数である)で表される化合物またはその加水分解物である請求項1記載の湿気硬化性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、硬化触媒の安定性が優れた湿気硬化性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】1液型の湿気硬化性ゴムとしては、シリコーン系ゴム、ウレタン系ゴム、ポリサルファイド系ゴム等が知られている。1液型の湿気硬化性ゴムは、一般に硬化が速く、2液型のものに比べ液の混合調整等の必要がない等、作業性の点で優れている。

【0003】しかし、シリコーン系ゴムのものは、周囲への汚染の可能性、表面への塗装性の点で問題があり、ウレタン系ゴムのものは、貯蔵安定性、耐候性、耐発泡性、変色等の点で問題がある。さらに、ポリサルファイド系ゴムについても、硬化性、周囲への汚染の可能性の点で問題がある。

【0004】変成シリコーン系ゴムは、ポリエーテル等を主鎖とする架橋可能な加水分解性珪素官能基を有する重合体であり、硬化触媒を用いて密封下では長期間安定であるが、湿気にさらすと急速に硬化してゴム状物質に変わる1液型組成物である(特公昭62-35421号公報、特開昭61-141761号公報、特開平1-58219号公報)。この重合体は、ポリウレタン系に比べ貯蔵安定性、耐候性、耐発泡性、耐変色性が良好であり、ポリサルファイド系に比べ、硬化性に優れ、周囲へ

の汚染性が少なく、毒性がない。また、通常のシリコーン系に比べ周囲への汚染性が少なく、表面への塗装性が良好である。この加水分解性珪素官能基を有する重合体の硬化触媒として、チタン酸エステル化合物、錫カルボン酸塩化合物、アミン化合物等が知られているが、一般的には、ジアルキル錫化合物が硬化触媒として主に使用されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしこれらのジアルキル錫化合物は、水分に対して安定性が十分でなく、組成物の貯蔵安定性および接着性、耐水性が著しく劣り、プライマー等を使用する必要があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 取り扱い性、安定性に優れた硬化触媒およびこれを主成 分とする変性シリコーン系温気硬化性組成物について検 討し、本発明に至った。

【0007】すなわち請求項1に係る発明は、分子末端 又は側鎖に、加水分解性基と結合した珪素原子を1分子 中に少なくとも1個有するシリル基含有有機重合体

(A) 100重量部と、硬化触媒(B) $0.1\sim10$ 重量部を主要成分とする組成物において、硬化触媒(B) が、ジアルキル錫化合物 $80\sim50$ 重量%とシリケート化合物 $20\sim50$ 重量%との混合物であることを特徴とする湿気硬化性組成物に関する。

【 0 0 0 8 】 さらに請求項 2 に係る発明は、ジアルキル 錫化合物が一般式(1):

$$R^1$$
₂ $S n X_2$ (1)

(式中、 R^1 は炭素原子数 $1\sim12$ の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基であり、Xは炭素原子数 $1\sim18$ の直鎖状または分岐鎖状のアルコキシル基、オルガノシリケート基、炭素原子数 $1\sim8$ の直鎖状または分岐鎖状のアセト酢酸アルキルエステル基、アセチルアセトン基よりなる群から選択される基である)で表される化合物である請求項1記載の湿気硬化性組成物に関する。

【0009】さらに請求項3に係る発明は、シリケート 化合物が一般式(2):

$$R_{m}^{2} Si (OR^{3})_{4-m}$$
 (2)

(式中、 R^2 および R^3 はそれぞれ独立に炭素数 $1\sim 4$ の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基であり、m個の R^2 、(4-m) 個の R^3 は同一であっても異なっていてもよく、mは $0\sim 3$ の整数である)で表される化合物またはその加水分解物である請求項1記載の湿気硬化性組成物に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明に用いる有機重合体(A)は、分子末端又は側鎖に加水分解性基と結合した珪素原子(以下、加水分解性基と結合した珪素基という場合がある)を1分子中に少なくとも1個有するシリル基含有有機重合体であり、その主鎖としては、アルキレンオキ

シド重合体ないしポリエーテル、エーテル・エステルブロック共重合体等が挙げられる。また、エチレン性不飽和化合物、ジエン系化合物の重合体等が挙げられる。前記アルキレンオキシド重合体ないしポリエーテルとしては、

 (CH_2CH_2O) n

(CHCH3CH2O) n

 $(CHC_2H_5CH_2O)$ n

 $(CH_2CH_2CH_2CH_2O)$ n

等の繰り返し単位を有するものが例示される。ここでnは、2以上の整数である。

【 0 0 1 1 】 また、エチレン性不飽和化合物、ジエン系 化合物の重合体としては、エチレン、プロピレン、アク リル酸エステル、メタクリル酸エステル、酢酸ビニル、 アクリロニトリル、スチレン、イソブチレン、ブタジエ ン、イソプレン、クロロプレン等の単独重合体またはこ れらの2種以上の共重合体等が挙げられる。より具体的 には、ポリブタジエン、スチレンーブタジエン共重合 体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、エチレン ブタジエン共重合体、エチレンープロピレン共重合 体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリ ル酸エステル共重合体、ポリイソプレン、スチレンーイ ソプレン共重合体、イソブチレンーイソプレン共重合 体、ポリクロロプレン、スチレンークロロプレン共重合 体、アクリロニトリルークロロプレン共重合体、ポリイ ソブチレン、ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル 酸エステル等が挙げられる。

【0012】加水分解性基と結合した珪素基は、湿気や 架橋剤の存在下、必要に応じて触媒等を使用することに より縮合反応を起こす基のことである。具体的には、ハ ロゲン化シリル基、アルコキシシリル基、アルケニルオ キシシリル基、アシロキシシリル基、アミノシリル基、 アミノオキシシリル基、オキシムシリル基、アミドシリ ル基等が挙げられる。ここで、1つの珪素原子に結合し たこれら加水分解性基の数は1~3の範囲から選択され る。また1つの珪素原子に結合した加水分解性基は1種 であってもよく、複数種であってもよい。さらに加水分 解性基と非加水分解性基が1つの珪素原子に結合してい てもよい。加水分解性基と結合した珪素基としては、取 り扱いが容易である点で、特にアルコキシシリル基(モ ノアルコキシシリル基、ジアルコキシシリル基、トリア ルコキシシリル基を含む)が好ましい。加水分解性基と 結合した珪素基は、重合体分子の末端に存在していて も、側鎖に存在していてもよい。加水分解性基と結合し た珪素基は、重合体の1分子当たり少なくとも1個あれ ばよいが、硬化速度、硬化物性の点からは、1分子当た り平均して1.5個以上あるのが好ましい。加水分解性 基と結合した珪素基を前記主鎖重合体に結合させる方法 としては公知の方法が採用できる。

【0013】本発明で用いる有機重合体(A)の分子量

は、特に制約はないが、過度に高分子のものは高粘度であり、硬化性組成物とした場合に使用上困難となるから、数平均分子量として30000以下が望ましい。このような有機重合体は、公知の方法によって製造することができるが、鐘淵化学工業(株)製のカネカMSボリマー等の市販品を使用してもよい。

【0014】本発明に用いる硬化触媒(B)としては、ジアルキル錫化合物とシリケート化合物の混合物が好ましく使用される。ここでジアルキル錫化合物とシリケート化合物の混合比は、両者の合計量に対して、ジアルキル錫化合物80~50重量%、シリケート化合物20~50重量%である。シリケート化合物が、20重量%未満であると触媒および硬化性組成物の安定化効果が十分でなく、一方50重量%より多く添加してもそれ以上の効果は表れない。

【0015】ジアルキル錫化合物としては、ジアルキル錫ジカルボキシレート、ジアルキル錫ジアルコキサイド、ジアルキル錫ビス(トリアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(モノアルキルジアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(ジアルキルモノアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(アセチルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アセチルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(トリアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(トリアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(モノアルキルジアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(ジアルキルモノアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(ジアルキルモノアルコキシシリケート)、ジアルキル錫ビス(アセチルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アセチルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アルキルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アルキルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アルキルアセトナート)、ジアルキル錫ビス(アルキルアセトカート)、ジアルキル

【0016】中でも、一般式(1)で表わされるジアル キル錫化合物が好ましい。一般式(1)において、 R^1 で表わされる炭素原子数1~12の直鎖状または分岐鎖 状のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、 イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tー ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、2 -エチルヘキシル、ラウリル等が挙げられる。Xで表わ される炭素原子数1~18の直鎖状または分岐鎖状のア ルコキシル基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキ シ、ブトキシ、イソブトキシ、sーブトキシ、tーブト キシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキ シ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ、ラウ リルオキシ、ステアリルオキシ等が挙げられる。Xで表 わされるオルガノシリケート基としては、トリアルコキ シシリケート、モノアルキルジアルコキシシリケート、 ジアルキルモノアルコキシシリケート、トリアルキルシ リケート等が挙げられる。ここで、アルコキシ基として は炭素原子数1~4のアルコキシ基が好ましく、具体的 にはメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキ

シ、ブトキシ、イソブトキシ、sーブトキシ、tーブトキシ等が挙げられ、アルキル基としては炭素原子数1~4のアルキル基が好ましく、具体的にはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブチル等が挙げられる。Xで表わされるアセト酢酸アルキルエステル基とは、アセト酢酸アルキルエステル中の2位のメチレン基の水素原子が1個取れた構造の1価の基を意味する。アセト酢酸アルキルエステルにおける炭素原子数1~8の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、イフチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、2ーエチルヘキシル等が挙げられる。Xで表わされるアセチルアセトン基とは、アセチルアセトン中のメチレン基の水素原子が1個取れた構造の1価の基を意味する。

【0017】一般式(1)で示されるジアルキル錫ジア ルコキサイドとしては、具体的には、ジメチル錫ジメト キサイド、ジメチル錫ジエトキサイド、ジメチル錫ジプ ロポキサイド、ジメチル錫ジブトキサイド、ジメチル錫 ビス(2-エチルヘキシルオキサイド)、ジメチル錫ジ ラウリルオキサイド、ジメチル錫ジステアリルオキサイ ド、ジブチル錫ジメトキサイド、ジブチル錫ジエトキサ イド、ジブチル錫ジプロポキサイド、ジブチル錫ジブト キサイド、ジブチル錫ビス(2-エチルヘキシルオキサ イド)、ジブチル錫ジラウリルオキサイド、ジブチル錫 ジステアリルオキサイド、ジオクチル錫ジメトキサイ ド、ジオクチル錫ジエトキサイド、ジオクチル錫ジプロ ポキサイド、ジオクチル錫ジブトキサイド、ジオクチル 錫ビス(2-エチルヘキシルオキサイド)、ジオクチル 錫ジラウリルオキサイド、ジオクチル錫ジステアリルオ キサイド、ジラウリル錫ジメトキサイド、ジラウリル錫 ジエトキサイド、ジラウリル錫ジプロポキサイド、ジラ ウリル錫ジブトキサイド、ジラウリル錫ビス(2-エチ ルヘキシルオキサイド)、ジラウリル錫ジラウリルオキ サイド、ジラウリル錫ジステアリルオキサイド等が挙げ られる。これらのジアルキル錫ジアルコキサイドは、ジ アルキル錫オキサイドと相当するアルコールを窒素雰囲 気下で加熱して反応させることで得られる。また、ジア ルキル錫オキサイドとフタル酸オクチルやラウリン酸工 チル等のエステル化合物とを窒素雰囲気下で加熱して反 応させることで得られる。

【0018】一般式(1)で表されるジアルキル錫ビス(トリアルコキシシリケート)としては、具体的には、ジメチル錫ビス(トリメトキシシリケート)、ジメチル 錫ビス(トリエトキシシリケート)、ジメチル錫ビス(トリブトキシシリケート)、ジブチル錫ビス(トリエトキシシリケート)、ジブチル錫ビス(トリアトキシシリケート)、ジオクチル錫ビス(トリエトキシシリケート)、ジオクチル錫ビス(トリエトキシシリケート)、ジオクチル錫ビス(トリエトキシシリケート)、ジオクチル

チル錫ビス(トリブトキシシリケート)、ジラウリル錫 ビス(トリメトキシシリケート)、ジラウリル錫ビス (トリエトキシシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリ ブトキシシリケート)等が挙げられる。

【0019】一般式(1)で表されるジアルキル錫ビス(モノアルキルジアルコキシシリケート)としては、具体的には、ジメチル錫ビス(メチルジエトキシシリケー

- ト)、ジメチル錫ビス(エチルジエトキシシリケー
- ト)、ジメチル錫ビス(ブチルジエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(メチルジエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(エチルジエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(ブチルジエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(メチルジエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(エチルジエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(ブチルジエトキシシリケー
- ト)、ジラウリル錫ビス(メチルジエトキシシリケー
- ト)、ジラウリル錫ビス(エチルジエトキシシリケー
- ト)、ジラウリル錫ビス(ブチルジエトキシシリケート)等が挙げられる。

【0020】一般式(1)で表されるジアルキル錫ビス (ジアルキルモノアルコキシシリケート)としては、具 体的には、ジメチル錫ビス(ジメチルエトキシシリケー

- ト)、ジメチル錫ビス(ジエチルエトキシシリケー
- ト)、ジメチル錫ビス(ジブチルエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(ジメチルエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(ジエチルエトキシシリケー
- ト)、ジブチル錫ビス(ジブチルエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(ジメチルエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(ジエチルエトキシシリケー
- ト)、ジオクチル錫ビス(ジブチルエトキシシリケー
- ト)、ジラウリル錫ビス(ジメチルエトキシシリケート)、ジラウリル錫ビス(ジエチルエトキシシリケー
- ト)、ジラウリル錫ビス(ジブチルエトキシシリケー
- ト)等が挙げられる。

【 O O 2 1 】 一般式(1)で表されるジアルキル錫ビス(トリアルキルシリケート)としては、具体的には、ジメチル錫ビス(トリメチルシリケート)、ジメチル錫ビス(トリメチルシリケート)、ジブチル錫ビス(トリンチルシリケート)、ジブチル錫ビス(トリンチルシリケート)、ジブチル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジオクチル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジオクチル錫ビス(トリンチート)、ジオクチル錫ビス(トリンチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリンチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリブチルシリケート)、ジラウリル錫ビス(トリブチルシリケート)等が挙げられる。

【0022】これらのジアルキル錫シリケート化合物は、ジアルキル錫オキサイドやジアルキル錫ジカルボキシレートとトリオルガノシシリケート化合物とを窒素雰

囲気下で加熱して反応させることで得られる。

【0023】一般式(1)で表されるジアルキル錫ビス (アセチルアセトナート)及びジアルキル錫ビス(アル キルアセトアセテート)としては、具体的には、ジメチ ル錫ビス(アセチルアセトナート)、ジブチル錫ビス (アセチルアセトナート)、ジオクチル錫ビス(アセチ ルアセトナート)、ジラウリル錫ビス(アセチルアセト ナート)等のジアルキル錫ビス(アセチルアセトナー ト) 化合物、ジメチル錫ビス(メチルアセトアセテー ト)、ジメチル錫ビス(エチルアセトアセテート)、ジ メチル錫ビス(ブチルアセトアセテート)、ジメチル錫 ビス (オクチルアセトアセテート)、ジブチル錫ビス (メチルアセトアセテート)、ジブチル錫ビス(エチル アセトアセテート)、ジブチル錫ビス(ブチルアセトア セテート)、ジブチル錫ビス(オクチルアセトアセテー ト)、ジオクチル錫ビス(メチルアセトアセテート)、 ジオクチル錫ビス(エチルアセトアセテート)、ジオク チル錫ビス (ブチルアセトアセテート)、ジオクチル錫 ビス(オクチルアセトアセテート)、ジラウリル錫ビス (メチルアセトアセテート)、ジラウリル錫ビス(エチ ルアセトアセテート)、ジラウリル錫ビス(ブチルアセ トアセテート)、ジラウリル錫ビス(オクチルアセトア セテート) 等のジアルキル錫ビス (アルキルアセトアセ テート)が挙げられる。これらのジアルキル錫ビス(ア セチルアセトナート)及びジアルキル錫ビス(アルキル アセトアセテート)は、ジアルキル錫オキサイドとアセ チルアセトンまたはアセト酢酸アルキルエステルを窒素 雰囲気下で加熱して反応させることで得られる。

【0024】これらのジアルキル錫化合物は前記の方法のほか、他の公知の方法で製造できるが、日東化成(株)製のネオスタンU-8、ネオスタンU-100、ネオスタンU-200、ネオスタンU-220、ネオスタンU-810、ネオスタンU-820等の市販品を使用してもよい。

【0025】本発明において、前記ジアルキル錫化合物と組み合わせて使用されるシリケート化合物としては、一般式(2)で表わされるシリケート化合物およびその加水分解物が好適に使用される。一般式(2)において、R²、R³で表される炭素原子数1~4の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ェーブチル、セーブチル等のアルキル基等が挙げられる。m個のR²は同一であってもよく、異なっていてもよい。また(4-m)個のR³は同一であっても、異なっていてもよい。

【0026】一般式(2)で表されるシリケート化合物 およびその加水分解物としては、具体的には、テトラメ トキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキ シシラン、テトライソプロポキシシラン、テトラブトキ シシラン等のテトラアルコキシシラン、およびそれらの 加水分解物、トリエトキシメチルシラン、トリエトキシ エチルシラン、トリエトキシプロピルシラン、トリエト キシイソプロピルシラン、トリエトキシブチルシラン等 のモノアルキルトリアルコキシシラン、およびそれらの 加水分解物、ジエトキシジメチルシラン、ジエトキシジ エチルシラン、ジエトキシジプロピルシラン、ジエトキ シジイソプロピルシラン、ジエトキシジブチルシラン等 のジアルキルジアルコキシシラン、およびそれらの加水 分解物、エトキシトリメチルシラン、エトキシトリエチ ルシラン、エトキシトリプロピルシラン、エトキシトリ イソプロピルシラン、エトキシトリブチルシラン等のト リアルキルモノアルコキシシラン、およびそれらの加水 分解物が挙げられる。加水分解物は取扱い性及び混合の しやすさ等から5量体以下が好ましい。これらの内、テ トラアルコキシシランまたはその加水分解物が好まし く、さらに好ましくはテトラエトキシシランである。

【 0 0 2 7 】本発明の湿気硬化性組成物においては、硬化触媒(B)の含有量は、シリル基含有有機重合体(A)100重量部に対して0.1~10重量部が好ましい。硬化触媒(B)の量が前記範囲未満では、硬化性能が不十分であり、一方前記範囲を超えると、硬化後の硬化物の復元率、耐候性等の物性が悪くなることがある。

【0028】本発明の湿気硬化性組成物には、硬化を促進し基材への密着性を良くするため、公知の種々のアミノ基置換アルコキシシラン化合物、またはその縮合物を使用することができ、具体的には、r-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(トリメトキシシリルプロピル)エチレンジアミン、 $\delta-$ アミノブチル(メチル)ジエトキシシラン、N, N'-ビス(トリメトキシシリルプロピル)エチレンジアミンおよびこれらの部分加水分解物等が挙げられる。

【0029】また本発明の湿気硬化性組成物には、さら に充填剤、着色剤、可塑剤、硬化促進剤、硬化遅延剤、 タレ防止剤、老化防止剤、溶剤等、硬化性組成物に通常 添加される添加剤を加えてもよい。例えば充填剤として は、具体的には、炭酸カルシウム、カオリン、タルク、 ヒュームドシリカ、沈降性シリカ、無水ケイ酸、含水ケ イ酸、クレー、焼成クレー、ガラス、ベントナイト、有 機ベントナイト、シラスバルーン、ガラス繊維、石綿、 ガラスフィラメント、粉砕石英、ケイソウ土、ケイ酸ア ルミニウム、水酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化マグ ネシウム、二酸化チタン等が挙げられる。着色剤として は、具体的には、酸化鉄、カーボンブラック、フタロシ アニンブルー、フタロシアニングリーン等が挙げられ る。可塑剤としては、具体的には、ジブチルフタレー ト、ジオクチルフタレート、ブチルベンジルフタレート 等のフタル酸エステル類、アジピン酸ジオクチル、コハ ク酸ジオクチル、コハク酸ジイソデシル、セバシン酸ジ

イソデシル、オレイン酸ブチル等の脂肪族カルボン酸エステル類、ペンタエリスリトールエステル等のグリコールエステル類、リン酸トリオクチル、リン酸トリクレジル等のリン酸エステル類、エポキシ化大豆油、エポキシステアリン酸ベンジル等のエポキシ系可塑剤、塩素化パラフィン等が挙げられる。タレ防止剤としては、具体的には、水添ヒマシ油、無水ケイ酸、有機ベントナイト、コロイド状シリカ等が使用される。また他の添加剤としては、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等の接着付与剤、紫外線吸収剤、ラジカル連鎖禁止剤、過酸化物分解剤、各種の老化防止剤等が挙げられる。

[0030]

【実施例】以下に本発明を実施例に基づいて具体的に説明するが、本発明の範囲はこれによって限定されるものではない。

【0031】製造例1

温度計、還流冷却器及び攪拌機を備えた500m1の四ツロフラスコに窒素気流下で、ジブチル錫オキシド49.8g(0.2mol)、2-エチルヘキサノール52.1g(0.4mol)、及びトルエン200gを仕

 C(%)
 H(%)

 測定値
 40.5
 8.2

 理論値
 40.6
 8.2

【0034】製造例3

製造例 1 と同じ四つ口フラスコにジブチル錫オキシド4 9.8 g (0.2 m o 1)、アセチルアセトン 4 0.0 g (0.4 m o 1)、及びトルエン 2 0 0 gを仕込み、製造例 1 と同様に反応、処理して淡黄色透明液体 C 8 1 .1 g (収率 9 4 %)を得た。この化合物は、FTーIRにて S n - O - C の吸収(5 4 7 c m - 1 0 的出現により、ジブチル錫ビス(アセチルアセトナート)の生成が確認できた。

【0035】製造例4

製造例 1 と同じ四つ口フラスコにジブチル錫オキシド4 9.8g(0.2mo1)、アセト酢酸エチル52.1g(0.4mo1)、及びトルエン200gを仕込み、製造例 1 と同様に反応、処理して淡黄色透明液体D 9 8.8g(収率97%)を得た。この化合物は、FT-IRにてSn-O-Cの吸収($550cm^{-1}$)の出現により、ジブチル錫ビス(エチルアセトアセテート)の生成が確認できた。

【0036】製造例5

	C (%)	Н (%)			
測定値	47.7	9.3			
理論值	47 8	9 2			

【0039】製造例7

製造例4のジブチル錫オキシドの代わりに、ジオクチル 錫オキシド72.2g(0.2mo1)を使用し、製造 例4と同様の配合で反応、処理し、淡黄色液体G10 4.3g(収率96%)を得た。この化合物は、FT- 込み、112°Cで2時間反応させ、生成した水を共沸脱水した後、減圧下でトルエンを留去して、淡黄色透明液体A 92.4g(収率94%)を得た。この化合物は、FT-IRにてアルコールのO-Hの吸収(3300~3400cm⁻¹)の消失とSn-O-Cの吸収(605cm⁻¹)の出現により、ジブチル錫ビス(2-エチルへキシルオキサイド)の生成が確認できた。

【0032】製造例2

製造例1と同じ四つロフラスコにジブチル錫オキシド49.8g(0.2mo1)、酢酸24.0g(0.4mo1)、及びトルエン200gを仕込み、製造例1と同様に反応処理した後、ついで正珪酸エチル(テトラエトキシシラン)83.3g(0.4mo1)を仕込み、120mcにて3時間反応させ、生成した酢酸エチルを減圧留去して淡黄色透明液体B114.7g(収率97%)を得た。この化合物は、FT-IRにて錫カルボニルの吸収(163mcm⁻¹、1559mcm⁻¹)の消失と次の元素分析の結果より、ジブチル錫ビス(トリエトキシシリケート)の生成が確認できた。

【0033】

O(%) Si(%) Sn(%) 21.7 9.5 20.1 21.6 9.5 20.1

製造例1と同じ四つ口フラスコにジブチル錫オキシド49.8g(0.2mo1)、フタル酸ジオクチル156.2g(0.4mo1)、及びトルエン200gを仕込み、製造例1と同様に反応、処理して淡黄色透明液体 E 199.8g(収率97%)を得た。この化合物は、FT-IRにてSn-O-Cの吸収(550cm $^{-1}$)の出現により、ジブチル錫ジオクチルオキサイドの生成が確認できた。

【0037】製造例6

製造例 2のジブチル錫オキシドの代わりに、ジオクチル 錫オキシド72.2g(0. 2m o 1)を使用し、製造 例 2 と同様の配合で反応、処理し、淡黄色液体 F 1 3 6. 5g(収率 9 7%)を得た。この化合物は、F T 1 R にて錫カルボニルの吸収(1 6 3 8 c m -1、1 5 5 9 c m -1)の消失と次の元素分析の結果より、ジオクチル錫ビス(トリエトキシシリケート)の生成が確認できた。

[0038]

O (%) Si (%) Sn (%) 17.9 8.1 17.0 18.1 8.0 16.9

IRにてSn-O-Cの吸収($547cm^{-1}$)の出現により、ジオクチル錫ビス(エチルアセトアセテート)の生成が確認できた。

【0040】製造例8

製造例2のジブチル錫オキシドの代わりに、ジメチル錫

オキシド33.0g(0.2mo1)を使用し、製造例 2と同様の配合で反応、処理し、淡黄色液体H99.4 g(収率98%)を得た。この化合物は、FT-IRに て錫カルボニルの吸収(1638cm⁻¹、1559cm

C (%) H (%)

測定値 33.2 7.3 理論値 33.2 7.1

【0042】実験例1~12および比較実験例1~8 <触媒の安定性試験>製造例1~8で得られた錫化合物 A~Hのそれぞれ50重量部に対し、正珪酸エチル(テトラエトキシシラン)50重量部を混合したもの(実験例1、3、5、7、9~12)、および製造例1~4で得られた錫化合物A~Dのそれぞれ50重量部に対し、エチルシリケート40(多摩化学工業(株)製ポリ珪酸エチルエステル(4~5量体))50重量部を混合したもの(実験例2、4、6、8)、並びに比較例として製造例1~8で得られた錫化合物A~Hにテトラエトキシ

-1)の消失と次の元素分析の結果よりジメチル錫ビス (トリエトキシシリケート)の生成が確認できた。 【0041】

O(%) Si(%) Sn(%)

25. 1 11. 1 23. 3

25. 2 11. 1 23. 4

シラン、エチルシリケート40を添加しないもの(比較実験例 $1\sim8$)を、透明なガラス瓶に入れ、室温にて静置して、状態を経時にて比較した。状態の判定は下記の基準に基づいて行った。結果を表1に示す。

○:クリアーな状態。

△:増粘または白濁が生じた。

×:ゲル化または沈殿が生じた。

[0043]

【表1】

	配 合 割 合(重量部数)				外 観							
	錫化合物	9	正珪酸 エチル	エチルシリ ケート40	1日後	3日後	5日後	7日後	14日後	1力月後	2カ月後	3カ月後
実験例1	錫化合物A	50	50	-	0	0	Δ	Δ	×	×	×	×
実験例2	錫化含物A	50	-	50	0	0	Δ	Δ	×	×	×	×
実験例3	錫化合物B	50	50	-	0	0	0	0	0	0	0	0
実験例4	錫化合物B	50	ı	50	0	0	0	0	0	0	0	0
実験例5	錫化合物C	50	50	_	0	0	0	0	0	Δ	Δ	Δ
実験例6	錫化合物C	50		50	0	0	0	0	0	Δ	Δ	Δ
実験例7	錫化合物D	50	50	-	0	0	Δ	Δ	×	×	×	×
実験例8	錫化合物D	50	-	50	0	0	Δ	Δ	×	×	×	×
実験例9	錫化合物E	50	50	-	0	0	0	0	0	0	0	0
実験例10	錫化合物F	50	50	-	0	0	0	0	0	0	0	0
実験例11	錫化合物G	50	50	1	0	0	Δ	Δ	×	×	×	×
実験例12	錫化合物H	50	50	_	0	0	0	0	0	0	0	0
比較実験例1	錫化合物A	100	_	_	Δ	×	×	×	×	×	×	×
比較実験例2	錫化合物B	100	1	-	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ
比較実験例3	錫化合物C	100	-	1	0	0	0	0	0	×	×	×
比較実験例4	錫化合物D	100	_	-	Δ	×	×	×	×	×	×	×
比較実験例5	錫化合物□	100	-	1	0	0	0	0	0	Δ	×	×
比較実験例6	錫化合物F	100	-	-	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ
比較実験例7	錫化合物G	100	-	-	Δ .	×	×	×	×	×	×	×
比較実験例8	錫化合物Ⅱ	100	-	_	0	0	0	0	0	0	Δ	Δ

【0044】実施例1~12および比較例1~8

実施例1、2、7、8、11及び比較例1、4、7は安定性試験3日終了後の触媒を、実施例5、6及び比較例3は安定性試験21日終了後の触媒を、実施例3、4、9、10、12及び比較例2、5、6、8は安定性試験3ヵ月終了後の触媒を各種材料と表2に示す配合比で室温25℃、湿度60%の恒温室にて混錬した後放置し、スナップタイム(半ゲル化状になるまでの時間)とタックフリータイム(表面タックのなくなるまでの時間)を測定した。結果を表2に示す。表2における材料は次ぎ

のものを表わす。

【0045】MSポリマーS303:加水分解性珪素基を含む重合体(鐘淵化学工業(株)製)

ノクラックNS−6 : 老化防止剤(大内新興化学工業(株)製)

DOP: ジオクチルフタレート

A-1100 : アミノ基置換アルコキシシラン

化合物(日本ユニカー(株)製)

[0046]

【表2】

【0047】表1、表2から明らかなように、本発明のジアルキル錫化合物とシリケート化合物からなる触媒を使用する硬化性組成物(実施例 $1\sim12$)は、触媒としてジアルキル錫化合物のみを含有する硬化性組成物(比較例 $1\sim8$)に比べ、空気中で安定であり、長期間触媒

活性が失活しないことがわかる。

[0048]

【発明の効果】本発明の湿気硬化性組成物は空気中で長期間触媒活性が失われず、シーリング剤、コーティング剤、弾性接着剤として有用である。

フロントページの続き

(72)発明者 田淵 均

大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目17番14 号 日東化成株式会社内 (72) 発明者 毛利 喜代美

大阪府大阪市東淀川区西淡路 3 丁目17番14 号 日東化成株式会社内

F ターム(参考) 4J002 CH051 CP022 CP032 CP181 EZ016 EZ036 EZ046 EZ056 FD146